

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】平成27年1月8日(2015.1.8)

【公開番号】特開2013-167669(P2013-167669A)

【公開日】平成25年8月29日(2013.8.29)

【年通号数】公開・登録公報2013-046

【出願番号】特願2012-29228(P2012-29228)

【国際特許分類】

G 0 3 F 7/11 (2006.01)

C 0 8 G 77/04 (2006.01)

G 0 3 F 7/038 (2006.01)

G 0 3 F 7/039 (2006.01)

H 0 1 L 21/027 (2006.01)

C 0 8 G 77/14 (2006.01)

【 F I 】

G 0 3 F 7/11 5 0 3

C 0 8 G 77/04

G 0 3 F 7/038 6 0 1

G 0 3 F 7/039 6 0 1

H 0 1 L 21/30 5 7 3

C 0 8 G 77/14

【手続補正書】

【提出日】平成26年11月17日(2014.11.17)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 8 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 1 8 1 】

[実施例、比較例]

上記合成例で得られたケイ素含有表面改質剤(1-1)~(1-31)、ポリマー成分としてのポリシロキサン化合物(2-1)~(2-8)、酸、熱架橋促進剤、溶剤、添加剤を表4-1~表4-3に示す割合で混合し、0.1 μmのフッ素樹脂製のフィルターで濾過することによって、ケイ素含有レジスト下層膜形成用組成物溶液をそれぞれ調製し、それぞれS o 1.1~52とした。